引力を持つ稀薄粉体ガスのレオロジーの理論

高田智史¹, 早川尚男²

京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 ² 京都大学 基礎物理学研究所

概要

せん断下における引力を持つ稀薄粉体ガスの粘性率を運動論から導出した。具体的には、引力の モデルとして井戸型ポテンシャルを考え、一様せん断下においてボルツマン方程式を解析するこ とで粘性率を導出した。また、対応する分子動力学シミュレーションを行うことで、理論の適用 範囲についての議論も行う。

Rheology of cohesive dilute granular gases

Satoshi Takada¹, Hisao Hayakawa²

 1 Department of Physics, Kyoto University 2 Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University

Abstract

The rheology of cohesive dilute granular gases is studied. We analyze the kinetic theory of granular gases having the square-well potential and derive the steady state shear viscosity under a plane shear. We also perform the event-driven molecular dynamics to check the validity of the kinetic theory.

1 はじめに

シアシックニングと呼ばれる、せん断率の増加に 伴い粘性率も増加する現象がある。この現象は物理 学的だけでなく工業的にも注目されており、メカニ ズムについて調べている様々な論文がある [1, 2, 3]。

ただし、これらの研究はシミュレーションを中心 に行われており、理論的な研究に目を向けると、エ ンスコッグ方程式を用い有限密度の効果で連続的な シアシックニングが現れることを示した Santos らの 論文 [4] があるものの未だ不十分な点が多い。本研 究においては一様せん断下における引力を持つ稀薄 粉体ガスを運動論を用いて解析することにより、シ ンプルなモデルから系のレオロジーを解明すること を目的とする。

2 一様せん断状態

質量 m、直径 d からなる粒子が一様に分布してい る系を考える。粒子間のポテンシャルとしては井戸 の深さ ε 、幅の比 λ で特徴づけられる井戸型ポテン シャルを用いる。この系に一様せん断、すなわち平 均流速が $u_x = \dot{\gamma}y, u_y = u_z = 0$ となるようにせん 断を加える ($\dot{\gamma}$ はせん断率)。稀薄な場合においては この系はボルツマン方程式

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \dot{\gamma} V_{1y} \frac{\partial}{\partial V_{1x}}\right) f(\mathbf{V}_1, t) = J(f, f), \quad (1)$$

で記述される。ここで、 $f(\mathbf{V},t)$ は分布関数、 $V_x = v_x - \dot{\gamma}y, V_y = v_y, V_z = v_z$ は特性速度、J(f, f)は

衝突積分

$$J(f,f) = \int d\boldsymbol{v}_2 \int d\hat{\boldsymbol{k}} \Theta(\min(\lambda,\nu) - \tilde{b}) v_{12}$$

$$\times [\chi_e \sigma(\chi, v_{12}'') f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_1'', t) f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_2', t) -\sigma(\chi, v_{12}) f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_1, t) f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_2, t)]$$

$$+ \int d\boldsymbol{v}_2 \int d\hat{\boldsymbol{k}} \Theta(\tilde{b} - \min(\lambda, \nu)) v_{12}$$

$$\times [\sigma(\chi, v_{12}'') f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_1'', t) f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_2', t) -\sigma(\chi, v_{12}) f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_1, t) f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}_2, t)], \quad (2)$$

である。ここで、 $\Theta(x)$ はステップ関数、 $v_{12} = |v_{12}| =$ $|v_1 - v_2|$ は i 番目と j 番目の粒子の間の相対速度、 $\nu \equiv (1 + 4\varepsilon/mv_{12}^2)^{1/2}$ は屈折率 [5, 6]、 $\tilde{b} = b/d$ は 無次元化した衝突パラメータ、χ_eは衝突前の速度 (v_1'', v_2'') と衝突後の速度 (v_1, v_2) との間の変換のヤ コビアンに関する量、 $\sigma(\chi, v_{12})$ は散乱断面積であ る。 χ は衝突パラメータbおよび相対速度 v_{12} によ り決まる散乱角である。井戸型ポテンシャルの場合、 (v_1'', v_2'') と (v_1, v_2) との間の関係式は以下のように 書ける [7]:

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}_{1} = \boldsymbol{v}_{1}'' - A(\boldsymbol{v}_{12}'' \cdot \hat{\boldsymbol{k}})\hat{\boldsymbol{k}} \\ \boldsymbol{v}_{2} = \boldsymbol{v}_{2}'' + A(\boldsymbol{v}_{12}'' \cdot \hat{\boldsymbol{k}})\hat{\boldsymbol{k}} \end{cases}$$
(3)

ここで

$$A = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2} \epsilon \nu^2 \frac{\cos^2 \Theta}{\cos^2 \theta} & (\tilde{b} \le \min(\lambda, \nu)) \\ 1 & (\tilde{b} > \min(\lambda, \nu)) \end{cases}, \quad (4)$$

に平行な単位ベクトル、 θ は v_{12} と \hat{k} とがなす角度、 $\Theta \equiv \cos^{-1} \{ 1 - b^2 / (\nu^2 d^2) \}^{1/2}$ である。

式 (1) に mV_{1i}V_{1j} を乗じ V₁ について積分するこ とで、ストレステンソルに関する時間発展

$$\partial_t P_{ij} + \dot{\gamma} (\delta_{ix} P_{yj} + \delta_{jx} P_{iy}) = -\Lambda_{ij}, \qquad (5)$$

が得られる。ここで、 Λ_{ij} は

$$\overleftrightarrow{\Lambda} \equiv -m \int d\boldsymbol{v}_1 \boldsymbol{V}_1 \boldsymbol{V}_1 J \left[\boldsymbol{V}_1 | f \right], \qquad (6)$$

で定義されるテンソルである。

解析を行っていくにあたり、分布関数が Grad の 13 モーメント [8]

$$f(\mathbf{V}) = f_{\rm M}(\mathbf{V}) \left[1 + \frac{m}{2T} \left(\frac{P_{ij}}{p} - \delta_{ij} \right) V_i V_j \right], \quad (7)$$

で与えられると仮定する。ここで $f_{\rm M}(V)$ = $n(m/2\pi T)^{3/2} \exp(-mV^2/2T)$ は Maxwell 分布であ り、p = nTである。

☆ はストレステンソルの対角項と非対角項の和 に分割することができ、

$$\overleftarrow{\Lambda} = \nu_1 (\overleftarrow{P} - p\mathbf{1}) + \zeta p\mathbf{1}, \qquad (8)$$

と書ける。ここで *v*1 は

$$\nu_{1} = \frac{8}{15} n d^{2} \sqrt{\frac{\pi T}{m}} \int_{0}^{\infty} dc_{12} \int_{0}^{\infty} d\tilde{b} A \tilde{b} c_{12}^{7} \\ \times \left[(1-A) + \frac{3}{2} A \cos^{2} \frac{\chi}{2} \right] \sin^{2} \frac{\chi}{2} \exp\left(-\frac{1}{2} c_{12}^{2}\right),$$
(9)

で与えられる。また ζ は一様冷却過程におけるエネ ルギー散逸率と一致し、

$$\zeta = \frac{8}{3}nd^2 \sqrt{\frac{\pi T}{m}} \int_0^\infty dc_{12} \int_0^\infty d\tilde{b} \\ \times A(1-A)\tilde{b}c_{12}^5 \sin^2 \frac{\chi}{2} \exp\left(-\frac{1}{2}c_{12}^2\right), \quad (10)$$

となる。

式 (5) と式 (8) より圧力 $p \equiv P_{ii}/3$ 、圧力差 $\Delta p \equiv$ $P_{xx} - P_{yy}$ 、シアストレス P_{xy} の時間発展の方程式

$$\begin{cases} \partial_t p + \frac{2}{3}\dot{\gamma}P_{xy} = -\zeta p\\ \partial_t \Delta P + 2\dot{\gamma}P_{xy} = -\nu_1 \Delta p &, \quad (11)\\ \partial_t P_{xy} + \dot{\gamma} \left(p - \frac{1}{3}\Delta p \right) = -\nu_1 P_{xy} \end{cases}$$

であり **k** は粒子が最接近した時の相対位置ベクトル が得られる。今回は定常状態の値に着目することに すると、式(11)より定常解

$$\dot{\gamma}_{\rm s} = \sqrt{\frac{3}{2} \frac{\nu_1^2 \zeta}{\nu_1 - \zeta}},\tag{12}$$

$$P_{xy,s} = -\frac{p}{\nu_1} \sqrt{\frac{3}{2}} \zeta(\nu_1 - \zeta), \qquad (13)$$

$$\Delta p = \frac{3\zeta}{\nu_1} p,\tag{14}$$

がそれぞれ得られる。ここで下文字のsは定常状態 に関する量であることを示す。図1に温度とせん断 率の関係(12)を示す。せん断率が小さい領域におい ては定常状態が存在せず、またせん断率が大きい領 域においてはせん断率の増加に伴って温度が増加す るブランチと温度が一定のブランチが存在すること がわかる。



図 1: 運動論 (赤実線) 及びシミュレーション (青 丸印) から得られた温度とせん断率の関係。ここで $e = 0.99, \lambda = 1.5$ であり、 $\dot{\gamma}_{\rm s}^{*} = \dot{\gamma}_{\rm s} (md^2/\varepsilon)^{1/2}$ 。

また、式 (12) と (13) より粘性率を計算すること ができ、

$$\eta_{\rm s} \equiv -\frac{P_{xy,{\rm s}}}{\dot{\gamma}_{\rm s}} = \frac{(\nu_1 - \zeta)p}{\nu_1^2}.$$
 (15)

が得られる。図2にせん断率(12)と粘性率(15)の関



図 2: 運動論 (赤実線) 及びシミュレーション (青丸 印) から得られたせん断率と粘性率の関係。ここで $e = 0.99, \lambda = 1.5, \eta_s^* = \eta d^2 / (m \varepsilon)^{1/2}$ 。

係を示している。粘性率の場合も温度と同様に、低 せん断領域においては粘性率が存在せず、高せん断 領域においては粘性率がせん断率に比例して増大す る Bagnold の領域とせん断率の -2 乗に比例して減 少するシアシニングの領域が見られることがわかる。

3 一様せん断状態の分子動力学シ ミュレーション

ション [9, 10] を行った。Lees-Edwards 境界条件 [11]

前章で行った解析の結果を比較するため、一様せん 断下に置いて event-driven な分子動力学シミュレー および Sllod 方程式 [12, 13] を用いることで一様せ ん断系を実現した。粒子数は $N = 10^3$ とし、シス テムサイズは L = 37.4d を用いた。また本研究にお いては充填率を $\phi = N(\pi d^3/6)/L^3 = 0.01$ 、はねか えり係数を e = 0.99、ポテンシャル井戸の幅の比を $\lambda = 1.5$ と固定した。

図 1、2 にシミュレーションで測定した温度とせん断率、およびせん断率と粘性率の関係を示している。高せん断率の場合には運動論で得られた 2 つのブランチのうち、Bagnold のブランチに一致した結果が得られている。その一方、シミュレーションにおいても低せん断率の場合においては定常状態が存在しない。実際、この場合に時間発展をプロットしてみると図 3 のように時間と共にクラスターが成長し、最終的にすべての粒子がクラスターに吸収されていくことがわかる。また、2 粒子の距離 r_{ij} が λd



図 3: 定常状態が存在しないせん断率領域における典型的な系の時間発展。(i) t = 0, (ii) 2400 t_0 , and (iii) 3500 t_0 。ここで $\dot{\gamma}_s^* = 0.003$ および $t_0 = (md^2/\varepsilon)^{1/2}$

以下の時にクラスタリングしていると判定すること で平均クラスターサイズの時間発展を測定した。図 4のようにせん断率が高い場合には平均クラスター サイズは一定なのに対し、低せん断率の場合には時 間と共に平均クラスターサイズは増加していき、最 終的にほとんど粒子がクラスターに吸収されている ことがわかる。



図 4: γ^{*} = 0.003(赤実線)、0.03(青破線) における 平均クラスターサイズの時間発展。

4 まとめ

本研究では引力を持つ稀薄粉体ガスに一様せん断 をかけた際の粘性率をボルツマン方程式を解析する ことによって導出した。その結果、せん断率が低い 場合には定常状態が存在せず、高せん断率の場合に は Bagnold のブランチとシアシニングのブランチの 2 つが現れることがわかった。これに対応した分子 動力学シミュレーションを行うと高せん断率の場合 には Bagnold のブランチが選ばれること、低せん断 率の場合にはクラスターが生成し一様状態が成り立 たなくなることがわかった。

参考文献

- M. Otsuki and H. Hayakawa, Phys. Rev. E 83, 051301 (2011).
- [2] R. Seto, R. Mari, J. F. Morris, and M. M. Denn, Phys. Rev. Lett. **111**, 218301 (2013).
- [3] T. Kawasaki, A. Ikeda and L. Berthier, EPL 107, 28009 (2014).
- [4] A. Santos, V. Garzó, and J. W. Dufty, Phys. Rev. E 69, 061303 (2004).
- [5] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Mechanics Third Edition (Course of Theoretical Physics) (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1976).
- [6] H. Goldstein, C. Poole, and J. Safko, *Classi-calMechanics Third Edition* (Addison Wesley, Boston, 2001).

- [7] S. Takada, K. Saitoh, and H. Hayakawa, Phys. Rev. E 94, 012906 (2016).
- [8] H. Grad, Commun. Pure Appl. Math. 2, 331 (1949).
- [9] B. J. Alder and T. E. Wainwright, J. Chem. Phys. **31**, 459 (1959).
- [10] M. N. Bannerman, R. Sargant, L. Lue, J. Comp. Chem. **32**, 3329 (2011).
- [11] A. W. Lees and S. F. Edwards, J. Phys. C 5, 1921 (1972).
- [12] D. J. Evans and G. P. Morriss, Phys. Rev. A 30, 1528 (1984).
- [13] D. J. Evans and G. Morriss, Statistical Mechanics of Nonequilibrium Liquids, 2nd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2008).